DOI:10.13878/j.cnki.jnuist.2021.04.009



薛泉<sup>1,2</sup>

曾丁元1 朱浩慎<sup>1,2</sup> 冯文杰<sup>2,3</sup> 车文荃<sup>1,2</sup>

# 24~30 GHz GaN HEMT 单片集成单刀双掷开关

#### 摘要

本文研究了一种基于 100 nm 氮化 镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT) 工艺设计的 24~30 GHz 单片集成单刀双 掷(SPDT)开关.该开关采用 1/4 波长微 带线并联 HEMT 开关器件的结构,通过 采用两级并联 HEMT 实现低插入损耗同 时获得更好的隔离度.测试结果显示,在 24~30 GHz 的 5G 毫米波频段内以及 0/ -5 V 的控制电压下,该开关的插入损耗 低于 1.5 dB,隔离度优于 28 dB,输入功 率 1 dB 压缩点大于 27 dBm.测试结果能 够很好地验证仿真结果.

### 关键词

GaN HEMT;单片微波集成电路;单 刀双掷开关

中图分类号 TN43 文献标志码 A

收稿日期 2021-07-03

**资助项目** 国家重点研发计划(2018YFB180200 2);广东省"珠江人才计划"引进创新创业团 队项目(2017ZT07X032)

### 作者简介

曾丁元,男,硕士生,主要从事毫米波微波 集成电路的研究.eed\_yuen@mail.scut.edu.cn

朱浩慎(通信作者),男,博士,副教授,主 要研究方向为微波毫米波器件与集成电路. zhuhs@scut.edu.cn

- 1 华南理工大学 电子与信息学院/广东省毫 米波与太赫兹重点实验室,广州,510641
- 2 琶洲实验室 智能感知与无线传输中心, 广州,510330
- 3 南京理工大学 电子工程与光电技术学院, 南京,210094

### 0 引言

由于 5G 移动通信技术的快速发展,Sub-6 GHz 频段拥挤的频谱 资源已难以满足 5G 无线通信的超高数据速率需求.毫米波频段具有 丰富的频谱,是 5G 技术发展的必然选择.3GPP 已经明确 n257(28 GHz)和 n258(26 GHz)频段为 5G 毫米波的优先部署频段.因此,近年 来在上述频段开展了较多的研究工作<sup>[1-2]</sup>,也得到非常多的关注.

在时分双工通信系统中,单刀双掷开关(Single-Pole Double-Throw,SPDT)控制发射和接收信号链路,通常置于天线与功率放大器 和低噪声放大器之间作为连接模块,是收发系统中的关键模块之一. 对于接收链路而言,开关的插入损耗直接影响整个系统的噪声性能, 而对于发射链路则主要影响输出的功率以及功率附加效率<sup>[3]</sup>.毫米波 频段前端模组中的开关,需要低的插入损耗来减小开关对整体系统 性能的恶化.在传统射频前端中,开关与功率放大器和低噪声放大器 通过封装实现互连往往引入额外的损耗与失配,尤其在毫米波频段, 对性能恶化尤为显著.因此,对于毫米波前端电路,各模块采用同种工 艺实现并单片集成有利于降低损耗,提升集成度.

过去,工作在毫米波频段的单刀双掷开关多使用 CMOS、GaAs 等 工艺实现<sup>[45]</sup>.CMOS 开关以其成熟的工艺技术,可以做到易集成、低 成本但是其器件的击穿电压低,功率容量受限.GaAs 开关拥有较低的 插入损耗以及隔离性能,但相较于近年来发展起来的 GaN 开关技术, 其衬底的热导率以及击穿电压较低,导致功率密度不及 GaN 开关.由 于宽禁带半导体 GaN 在大功率射频功放的功率密度以及效率等方面 具有显著优势,成为近年来的研究热点.随着 5G 毫米波技术的发展, 研究大功率高效率毫米波集成前端具有广阔的应用前景.近期研究表 明,GaN开关也可实现良好的插入损耗和隔离度性能.因此,利用 GaN 单片微波集成电路技术(MMIC)实现射频开关并与 GaN 功率放大器 和低噪声放大器实现单片集成,可在大功率毫米波前端方面获得更 优的性能<sup>[6]</sup>.2015年中国电子科技集团公司第十三研究所的郭丰强 等<sup>[7]</sup>设计出了工作在 Ku 波段的 GaN 大功率单刀双掷开关,其插入损 耗小于 0.9 dB,隔离度大于 27 dB,可承受 10 W 的连续波输入功率; 2015年北京理工大学的郭德淳教授团队在第16届通信技术国际会 议上发表了 Ka 波段的宽带 GaN 开关,采用 1/4 波长转换并联结构, 且并联晶体管采用两个对称并联形式以增大隔离度,设计的开关在 30~40 GHz 频带内插入损耗小于 2 dB,隔离度优于 25 dB,回波损耗优于 18 dB,输入功率 1 dB 压缩点 可达 39 dBm<sup>[8]</sup>;2019 年罗马第二大学的 Polli 等<sup>[9]</sup> 采用 100 nm GaN 工艺设计出了一款应用于空载卫 星的 Ka 波段单刀双掷开关,不同于传统并联开关结构,该开关使用串联晶体管感性谐振结构,33~39 GHz 频带内实现了插入损耗为 1.1 dB,隔离度为 22 dB,以及 39 dBm 的输入功率 1 dB 压缩性能;2019 年德国弗莱堡应用固体物理研究所的 Thome 等<sup>[10]</sup> 采用 100 nm GaN 工艺设计了一款 28~51 GHz 的单 刀双掷开关,采用 1/4 波长转换并联结构,插入损耗 为 1.4~2 dB,隔离度为 23.5~27 dB.

本文基于硅基 GaN 工艺设计了一款工作在24~30 GHz 的单刀双掷开关,可同时覆盖 5G 毫米波的 n257 和 n258 频段.该开关通过采用 1/4 波长转换并 联结构来兼顾插入损耗和隔离度性能,输入输出端 口均串联 MIM 电容隔离直流成分并参与匹配.测试 结果显示所设计的开关插入损耗在 24~30 GHz 内, 插入损耗低于 1.5 dB,隔离度优于 28 dB,输入功率 1 dB 压缩点大于 27 dBm(-5 V 栅极偏置下),电路 面积为 1.08 mm<sup>2</sup>.

### 1 SPDT 开关电路设计

本文研究的 GaN 开关采用 OMMIC 的 100 nm 的硅基 GaN 工艺(D01GH)适合微波和毫米波应用, 其工艺截面如图 1 所示,包含空气桥,使用两层互联 金属 IN 和 MET1,可以实现绕线电感和微带传输线. 有高低密度两种类型的电容以及两种类型的电阻, 高阻值电阻使用 GaN 有源层实现,铬镍金属电阻阻 值较低但精度高,通孔穿过 100 μm 的高电阻率硅基 板减少对地寄生电感.采用 AlGaN/GaN 异质结高电子迁移率晶体管(HEMT)作为开关器件,具有 100 nm 栅长的蘑菇型栅极,使用再生长的欧姆接触减小源极接触电阻,特征频率( $f_i$ )和最大振荡频率( $f_{max}$ )分别为 110 GHz 和 160 GHz.30 GHz 测试的功率密度为 3.3 W/mm,击穿电压为 40 V<sup>[11]</sup>.HEMT 作为开关器件时的导通电阻( $R_{on}$ )和关断电容( $C_{off}$ )分别为 1.4 Ω·mm 和0.45 pF/mm.

对于开关电路设计,通常由 HEMT 器件的栅极 电压控制信号导通或者关闭.毫米波频段的寄生效 应严重,而开关器件的导通电阻和关断电容直接决 定了开关的插入损耗和隔离度性能,需仔细考虑开 关的尺寸以获得满足要求的性能.一般而言,当 HEMT 器件栅极电压 V。大于其截止电压时, HEMT 器件导通,可简单等效为导通电阻 R....而 HEMT 栅 极电压低于截止电压时,HEMT 器件截止,可简单等 效为关闭电容  $C_{\text{off}}$  ·  $R_{\text{off}}$  与  $C_{\text{off}}$  的值越小则会获得越好 的开关性能.如图 2 所示:随着 HEMT 器件栅宽增 大,R<sub>w</sub>减小,C<sub>off</sub>增大;HEMT 器件栅宽减小,则 R<sub>w</sub>增 大, C<sub>af</sub>减小. 当栅宽为 200 μm 的时候, 开关器件的  $R_{or}$ 约为 6.8  $\Omega$ ,  $C_{off}$ 约为 91 fF, 此时可获得较好的插 入损耗和隔离度性能.若使用单级 HEMT 器件并联 开关电路,则整体开关电路的隔离度为 20 dB 左右, 不满足设计需求.而为保证较低的插入损耗,HEMT 器件栅宽不能增大以减小 R...来优化隔离度性能.故 需使用两级并联的开关电路,第二级选择较小栅宽 的 HEMT 器件, 如 100  $\mu$ m 栅宽, 以获得较小的  $C_{\text{off}}$ 值,避免开关电路插入损耗性能恶化,同时两级并联 结构又能获得较好的开关隔离度.

本文设计的 SPDT 开关为 1/4 波长转换并联结



Fig. 1 The cross section of OMMIC D01GH process



图 2 不同栅宽开关器件的导通电阻和关断电容 Fig. 2  $R_{on}$  and  $C_{off}$  of the HEMT with different gate widths

构,两条支路为对称结构,每条支路使用两级 HEMT 器件并联的拓扑以获得较大的隔离度.图 3 为设计 的开关电路的拓扑结构.TL1 和 TL2 为微带传输线, 理论上长度为 1/4 波长时可以获得良好的隔离度, 但一般只适用于频带较窄的设计.因此,在本文的设 计中,需要适当调节其长度.此外,当 M1 和 M3 关闭 时,该条支路导通,TL2 与 M1 和 M2 关闭状态下的 等效电容  $C_{\text{off1}}$ 和  $C_{\text{off2}}$ 组成  $\pi$  型电路,并与 TL1 完成 阻抗变换. $C_1$ 和  $C_2$ 均为 MIM 电容参与电路的输入 和输出匹配,并可隔离直流成分.



图 3 SPDI 开天拍打着构 Fig. 3 Topology of the proposed SPDT switch

利用电磁仿真工具 ADS 进行优化仿真,第一级 HEMT 器件 M1 和 M2 需选取较大尺寸以降低导通 电阻增大隔离度,而第二级 HEMT 器件 M3、M4 尺寸 较小,减小关断电容降低插入损耗.最终优化后选取 M1 和 M2 的栅宽为 200  $\mu$ m,M3 和 M4 的栅宽为 100  $\mu$ m. $C_1$  为 180 fF, $C_2$  为 700 fF.该工艺 50 Ω 特性阻抗 线宽为 83  $\mu$ m 左右,不利于电路版图布局.故电路中 微带线宽度均为 40  $\mu$ m,其特性阻抗约为 67 Ω,与电 路中其他元件互连并参与匹配.栅极电阻 R 用以隔 离泄漏至栅极的射频信号,此处栅极电阻 R 的值为 4 kΩ.电路整体控制电压使用两个 PAD,控制电压为 0 V 和-5 V.

### 2 仿真与测试结果

基于 100 nm GaN 工艺实现 24~30 GHz 的 SPDT 开关,电路版图如图 4a 所示,电路加工实物照片如 图 4b 所示,电路尺寸为 630 µm×1 720 µm.开关的测 试方案如图 5 所示,使用 R&S (B ZVA67 矢量网络分 析仪进行测试.采用在片的短路、开路、负载、馈通校 准方案(SOLT)对电路 3 个端口进行校准.如图 5b 所 示,由于网络分析仪输出的信号功率有限,故大信号 S 参数测试时在待测开关的输入端口加入了驱动放 大器来增大网络分析仪输入开关的信号功率,并在 开关导通支路的输出端加入衰减器,衰减进入网络 分析仪的信号功率.

SPDT 开关电路经在片测试,得到图 6 所示的仿 真与测试结果.测试时,如图 4b 所示,一条支路的控 制电压  $V_{g2}$ 为0 V,该条支路断开;另一支路控制电压  $V_{g1}$ 为-5 V,该支路导通.图 6a 为开关的输入输出回 波损耗曲线, $S_{11}$ 和  $S_{22}$ 为导通支路输入端口 1 和输出 端口 2 的回波损耗,24~30 GHz 频带内测试的输入 回波损耗大于 15 dB,输出回波损耗大于 12 dB,均优 于仿真结果.图 6b 为开关的插入损耗( $S_{21}$ )和隔离度 ( $S_{31}$ 、 $S_{23}$ )曲线,24~30 GHz 频带内,测试的插入损耗 低于 1.5 dB(最低为 1.18 dB),基本符合仿真结果; 测试的关断支路的端口 3 至公共端口 1 之间的隔离 度为 28.8~30.8 dB,导通支路的端口 2 至关断支路 的端口 3 之间的隔离度为 29~30 dB,均优于仿真结 果 2~3 dB,说明实际 HEMT 晶体管的寄生参数与仿 真模型稍有差别.

图 7 是 SPDT 开关的大信号仿真结果.由图 7a 可以看出开关在 24~30 GHz 频带内的输入 1 dB 功 率压缩点大于 30 dBm.经过对电路的简单测试,得到 大信号 S 参数的测试结果如图 7b 所示, X<sub>ep</sub>表示插 入损耗压缩曲线, S<sub>21</sub>为大信号输入下的插入损耗性 能曲线, P<sub>in</sub>为测试时的输入功率.当输入功率为 27 dBm 时,插入损耗还未压缩至 1 dB,可知此开关的输 入功率 1 dB 压缩点大于 27 dBm.测试时的开关电路 输入端接入了驱动放大器,导通支路输出端接了衰 减器,与后仿真的电路环境有所区别,引入了一定的 损耗, 故测试的输入 1 dB 压缩点与后仿真结果有一 定差距.表 1 对比了已发表的一些毫米波频段的

# **南京信息工だメ学**学报(自然科学版),2021,13(4):444-449

Journal of Nanjing University of Information Science & Technology(Natural Science Edition), 2021, 13(4):444-449



b. SPDT开天实物照片
图 4 SPDT 开关电路版图和实物显微照片
Fig. 4 Layout (a) and micrograph (b) of the SPDT switch



Fig. 5 Measurement setup of the SPDT switch a.small signal; b.large signal

GaN单刀双掷开关的工作,可以看到本文基于 GaN 的开关电路在 28 GHz 毫米波频段拥有优异的插入 损耗以及隔离度性能,有利于集成高性能 GaN 毫米 波前端.

## 3 结束语

本文基于 1/4 波长转换并联的两级开关拓扑结构,采用硅基 100 nm GaN 工艺设计并实现了一种毫 米波 SPDT 开关.电路测试结果表明该 SPDT 开关在

曾丁元,等.24~30 GHz GaN HEMT 单片集成单刀双掷开关. ZENG Dingyuan, et al. A 24-30 GHz GaN HEMT SPDT switch MMIC.



图 6 SPDT 开关仿真与测试结果

Fig. 6 Simulation and measurement results of the SPDT switch a.return loss; b.insertion loss and isolation





Fig. 7 Simulation (a) and measurement (b) results of the large signal S-parameter  $(S_{21})$  for the SPDT switch

		Table 1	Performance comparison with prior arts			
	工艺	带宽/GHz	插入损耗/dB	隔离度/dB	IP1dB∕dBm	面积/mm <sup>2</sup>
文献[8]	0.15 µm GaN/SiC	30~40	1.86(最小值)	27	39	
文献[9]	0.1 µm GaN∕Si	33~39	1.1(最小值)	22	39	4.5
文献[10]	0.1 µm GaN/SiC	28~51	1.4~2	23.5~27		1.25
本文	0.1 µm GaN∕Si	24~30	1.2~1.5	28.8~30.8	>27	1.08

表1 与已有文献的性能比较

24~30 GHz 的范围内实现了 1.2~1.5 dB 的插入损 耗,隔离度为 28.8~30.8 dB,输入功率 1 dB 压缩点 大于 27 dBm,在插入损耗、隔离度和功率容量上都 表现出了优良的性能,适用于单片集成的 GaN 毫米 波前端组件,在 5G 毫米波相控阵系统上具有较好的 应用前景.

### 参考文献

#### References

[1] Lee K H, Choi S, Kim C Y. A 25-30 GHz asymmetric

SPDT switch for 5G applications in 65-nm triple-well CMOS[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2019, 29(6):391-393

- [2] Kim H T, Park B S, Song S S, et al. A 28-GHz CMOS direct conversion transceiver with packaged antenna array for 5G cellular system [J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2018, 53(5):1245-1259
- [3] Thome F, Leuther A, Ambacher O. Low-loss millimeterwave SPDT switch MMICs in a metamorphic HEMT technology [J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2020, 30(2):197-200
- [4] Uzunkol M, Rebeiz G. A low-loss 50 70 GHz SPDT switch in 90 nm CMOS[J].IEEE Journal of Solid-State

### **南京信息工ビ大学**学报(自然科学版),2021,13(4):444-449

Journal of Nanjing University of Information Science & Technology (Natural Science Edition), 2021, 13(4):444-449

Circuits, 2010, 45(10): 2003-2007

- [5] Zhang L, Cheng X, Deng X J, et al. Design of K/Ka-band passive HEMT SPDT switches with high isolation [C] // 2017 China Semiconductor Technology International Conference (CSTIC), 2017:1-3
- [6] Campbell C F, Dumka D C. Wideband high power GaN on SiC SPDT switch MMICs[C] // 2010 IEEE MTT-S International Microwave Symposium, 2010:145-148
- [7] 郭丰强,要志宏.Ku 波段 GaN 大功率单刀双掷开关设 计[J].半导体技术,2015,40(11):835-839 GUO Fengqiang,YAO Zhihong.Design of a Ku-band GaN high power single-pole double-throw switch[J].Semiconductor Technology,2015,40(11):835-839
- [8] Guo D C, Qiao T, Luo X B, et al. Design of a Ka-band broadband SPDT switch MMIC based on GaN HEMTs

[C] // 2015 IEEE 16th International Conference on Communication Technology (ICCT), 2015:241-243

- [9] Polli G, Longhi P E, Colangeli S, et al. GaN/Si Ka-band SPDT for observation payloads [C] // 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference (APMC), 2019:288-290
- [10] Thome F, Brückner P, Quay R, et al. Millimeter-wave single-pole double-throw switches based on a 100-nm gatelength AlGaN/GaN-HEMT technology [C] // 2019 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS), 2019:1403-1406
- [11] Gasmi A, Kaamouchi M E, Poulain J, et al. 10 W power amplifier and 3 W transmit/receive module with 3 dB NF in Ka band using a 100 nm GaN/Si process [C] // 2017 IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium (CSICS), 2017:1-4

# A 24-30 GHz GaN HEMT SPDT switch MMIC

ZENG Dingyuan<sup>1</sup> ZHU Haoshen<sup>1,2</sup> FENG Wenjie<sup>2,3</sup> CHE Wenquan<sup>1,2</sup> XUE Quan<sup>1,2</sup>

1 School of Electronic and Information Engineering/Guangdong Provincial Key Laboratory of

Millimeter-Wave and Terahertz, South China University of Technology, Guangzhou 510641

2 Intelligent Sensing and Wireless Transmission Center, Pazhou Laboratory, Guangzhou 510330

3 School of Electronic and Optical Engineering, Nanjing University of Science & Technology, Nanjing 210094

Abstract A 24-30 GHz monolithic integrated Single-Pole Double-Throw (SPDT) switch based on 100 nm Gallium Nitride (GaN) High Electron Mobility Transistor (HEMT) process is presented in this paper. This switch adopts a quarter-wavelength microstrip line with parallel HEMT devices topology. By using two-stage parallel HEMT design, the SPDT achieves greater isolation while maintaining good Insertion Loss (IL). With a control voltage of 0/ -5 V, the measured IL of this SPDT is less than 1.5 dB, the isolation is greater than 28 dB, and the input power 1 dB compression point is greater than 27 dBm within 24-30 GHz 5G millimeter-wave frequency bands. The measurement results well verify the simulations.

Key words GaN HEMT; monolithic microwave integrated circuit (MMIC); SPDT switch